

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 25 年 1 月 24 日 (2013.1.24)

【公表番号】特表 2012-511174 (P2012-511174A)
 【公表日】平成 24 年 5 月 17 日 (2012.5.17)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-019
 【出願番号】特願 2011-539499 (P2011-539499)
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/00 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 3 F 7/095 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/00 5 0 2

G 0 3 F 7/20 5 1 1

G 0 3 F 7/095

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 11 月 30 日 (2012.11.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

異なる輻射線感度を有する 2 層又は 3 層以上の輻射線感受性層、及び赤外線アブレーション可能層を含んで成るレリーフ印刷前駆体であって、

前記アブレーション可能層が、前記 2 層又は 3 層以上の輻射線感受性層が応答する画像形成輻射線に対して不透明であるレリーフ印刷前駆体。

【請求項 2】

自己支持型であり、前記輻射線感受性層のうちの 1 層が硬化されて、基体を提供することができる請求項 1 に記載の前駆体。

【請求項 3】

透明基体をさらに含み、前記赤外線アブレーション可能層が、前記透明基体の前記 2 層又は 3 層以上の輻射線感受性層とは反対側にある請求項 1 に記載の前駆体。

【請求項 4】

第一の λ_{max} を含む第一の画像形成輻射線に対して感受性を有する第一の輻射線感受性層、

前記第一の λ_{max} と少なくとも 25 nm 異なる第二の λ_{max} を含む第二の画像形成輻射線に対して感受性を有する、前記第一の輻射線感受性層の上に配置された第二の輻射線感受性層、及び

任意選択の、前記第一及び第二の画像形成輻射線に対して不透明であり、赤外線吸収化合物を含む、前記第二の輻射線感受性層の上に配置された赤外線アブレーション可能層を少なくとも含んで成る請求項 1 又は 2 に記載の前駆体。

【請求項 5】

前記第一の λ_{max} が 290 ~ 400 nm であり、前記第二の λ_{max} が 290 ~ 320 nm である請求項 4 に記載のレリーフ印刷前駆体。

【請求項 6】

前記第二の輻射線感受性層が、前記第一の画像形成輻射線に対して透明でもある請求項

4 又は 5 に記載のレリーフ印刷前駆体。

【請求項 7】

前記第二のユニットが、前記第二の輻射線感受性層の上に配置された可剥性保護層をさらに含む請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載のレリーフ印刷前駆体。

【請求項 8】

以下の工程を含んで成るレリーフ印刷画像を形成する方法：

A) 赤外線アブレーションエネルギーに対して請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載のレリーフ印刷前駆体を像様露光して、前記赤外線アブレーション可能層にマスク画像を形成又は改変する工程、

B) 工程 A の次に、又は工程 A と同時に、前記マスク画像を通して第二の画像形成輻射線に対して前記レリーフ印刷前駆体を露光する工程、及び

C) 任意選択的に、追加の赤外線アブレーションエネルギーを用いて前記マスク画像を改変して改変されたマスク画像を形成する工程。

【請求項 9】

D) 次に前記改変されたマスク画像を通して第一の画像形成輻射線に対して前記レリーフ印刷前駆体を露光する工程をさらに含む請求項 8 に記載の方法。

【請求項 10】

工程 D の前に、前記輻射線感受性層が、第一のユニットとして、前記第二輻射線感受性層及び前記赤外線アブレーション可能層を含む第二のユニットに積層される請求項 9 に記載の方法。

【請求項 11】

前記第二のユニットが、前記第一及び第二のユニットの積層前に剥離される可剥性保護層をさらに含む請求項 10 に記載の方法。

【請求項 12】

工程 A 及び B の後に、前記第一の輻射線感受性層が、第一のユニットとして、前記第二輻射線感受性層及び前記赤外線アブレーション可能層を含む第二のユニットに積層される請求項 9 ～ 11 のいずれか 1 項に記載の方法。